



新聞

即時發布

VEECO 和 ALLOS 演示業界領先的 200MM GAN-ON-SILICON 性能來實現 MICRO-LED 的應用

Plainview, N.Y., 2017 年 11 月 1 日 - Veeco Instruments Inc. (Nasdaq: VECO) 今天宣布與 ALLOS Semiconductors (ALLOS) 完成一項戰略措施，以展示 200mm 矽基板用於氮化鎵藍/綠光 Micro-LED 的生產上。Veeco 與 ALLOS 合作將其專有的磊晶技術轉移到 Propel® Single-Wafer MOCVD 系統上，以便於現有的矽生產線上實現生產 Micro-LED。

“使用 Propel 反應腔，我們就擁有了一項 MOCVD 技術來實現高產能的 GaN 磊晶，可滿足在 200mm 矽生產線上生產 Micro-LED 元件的所有要求，”ALLOS 半導體公司執行長 Burkhard Slischka 表示。不到一個月的時間，我們就已經在 Propel 上建立了我們的技術，並且獲得了無裂紋、無回熔 (meltback-free) 的晶圓，其翹曲度低於 30 微米，晶體質量高，優異的厚度均勻性與小於 1nm 的波長均勻性。和 Veeco 一起，ALLOS 期待將這種技術更廣泛地應用於 Micro-LED 的產業中。 ”

Micro-LED 顯示技術由 < 30x30 平方微米的紅色，綠色，藍色 (RGB) 無機 LED 所組成，再轉化為顯示器背板以形成子像素。與 OLED 和 LCD 相比，這些高效率 LED 直接發射且耗電量更低，卻可以為移動顯示器，電視機和穿戴式裝置提供卓越的亮度和對比度。Micro-LED 的製造需要高質量、均勻的磊晶晶片來滿足顯示器的產量和成本控制的目標。

“與競爭對手的 MOCVD 平台相比，由於 Veeco 的 TurboDisc® technology 提供了更廣泛的製程範圍，因此 Propel 提供了一流的均勻性同時還能獲得優良的薄膜品質。” Veeco 高級副總裁兼 MOCVD 營運總經理 Peo Hansson 博士表示。 “將 Veeco 領先的 MOCVD 專業技術與 ALLOS 的 GaN-on-Silicon 的磊晶技術結合在一起，使我們的客戶能夠開發出低成本的 Micro-LED，為新的市場中的開拓出新的應用。 ”

關於 Veeco

Veeco (NASDAQ: VECO)是一家創新的半導體製程設備的領先製造商。我們經過驗證的 MOCVD、光刻 (lithography)、雷射退火 (laser annealing)、離子束和單晶片蝕刻和清潔技術在固態照明和顯示器以及先進的半導體元件製造領域發揮重要作用。憑藉旨在最大限度地提高性能、產量和擁有成本的設備，Veeco 在所有這些服務市場中擁有技術領先地位。 要了解有關 Veeco 創新設備和服務的更多信息，請訪問 www.veeco.com

關於 ALLOS Semiconductors

ALLOS 是一家知識產權許可和技術工程公司，幫助全球半導體行業的客戶掌握 GaN-on-Si 技術並充分發揮其優勢。 ALLOS 正在為其技術知識和專利提供授權，並將技術轉移到客戶的 MOCVD 反應腔。此外，ALLOS 也正為客戶提供特定的解決方案為下一代 GaN-on-Si 開發中所面臨挑戰的諮詢服務。

###

Veeco Instruments Inc.
Investors:
Sam Maheshwari
516-677-0200 x1472
investorrelations@veeco.com

Media:
Jeffrey Pina
516-677-0200 x1222
jpina@veeco.com

ALLOS Semiconductors GmbH
Alexander Loesing
Breitscheidstrasse 78, 01237 Dresden, Germany
Phone: +49-351-212 937-20
Email: alexander.loesing@allos-semiconductors.com
www.allos-semiconductors.com